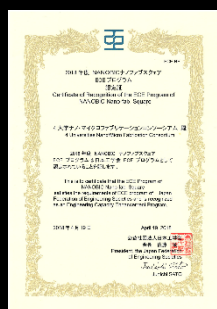


令和7年度 第3回 ナノファブスクエア in 海老名 講習・実習会

シリコン酸化



初心者
歓迎



日本工学会
ECEプログラム認定



日時

令和7年6月5日(木)
13:30~16:30

場所

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所
海老名本部 (神奈川県海老名市下今泉705-1
小田急線・相鉄線・JR相模線の海老名駅から徒歩15分)

講師

塩尻 大士 (神奈川県立産業技術総合研究所 電子技術部)

実習内容

熱酸化の原理を説明し、高温で水蒸気雰囲気での電気炉で、シリコン表面を熱酸化して酸化膜を形成しフォトリソグラフィを行う実習を行います。

実習機器

- 酸化拡散装置

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。今回は、KISTECの設備・装置を使った実習を行います。

定員 : 先着5名 参加費 : 13,000円(税込、テキスト代込)

※川崎市中小企業に対する、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金の適用はございません。

主催 : 4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアム, (地独)神奈川県立産業技術総合研究所, 川崎市



問い合わせ先

(地独) 神奈川県立産業技術総合研究所 海老名本部 Tel:046-236-1500 (代表)

技術担当 菅間 電子技術部 /E-mail : sugama@kistec.jp

事務担当 人材育成部 /E-mail : sm_sangyoujinzai@kistec.jp